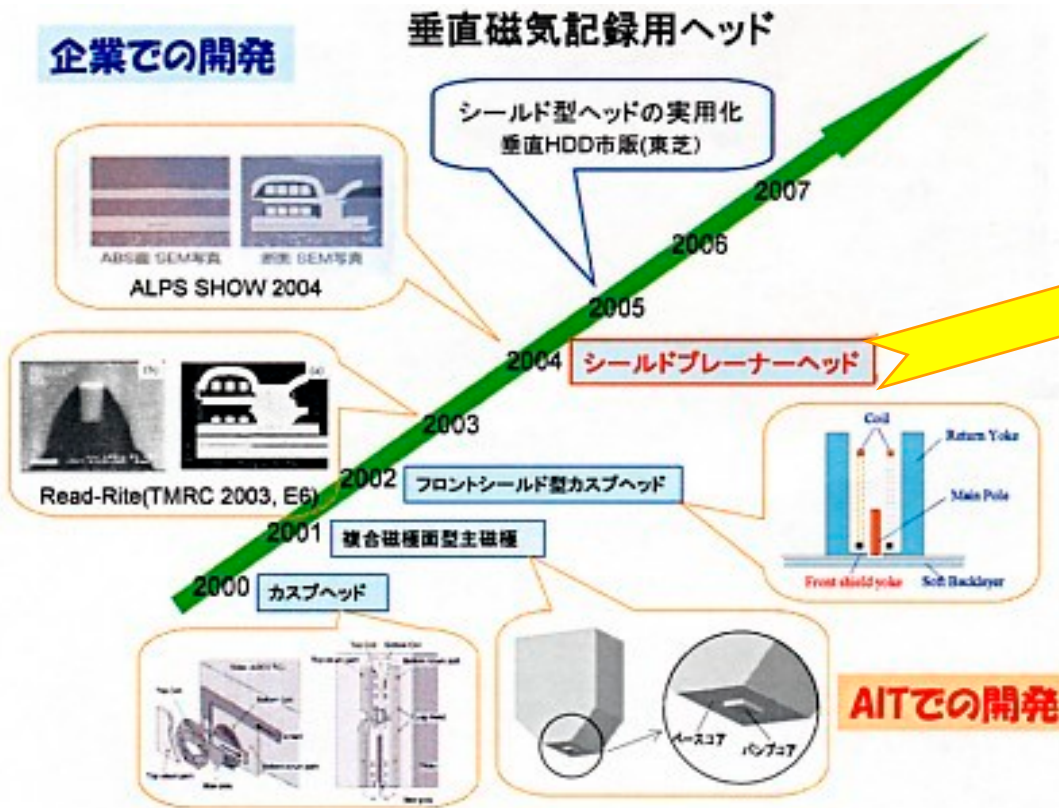


シールドプレーナヘッド

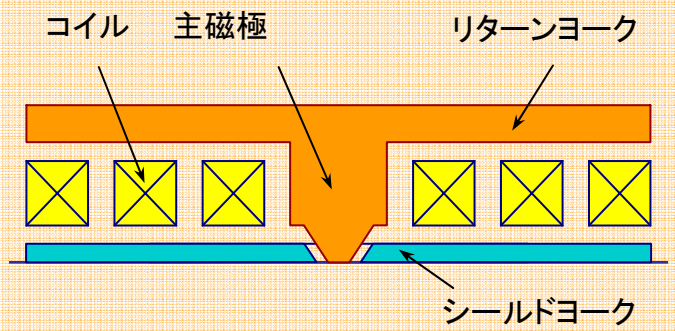
1Tbit/in² 記録を目指したプレーナヘッド

企業での開発



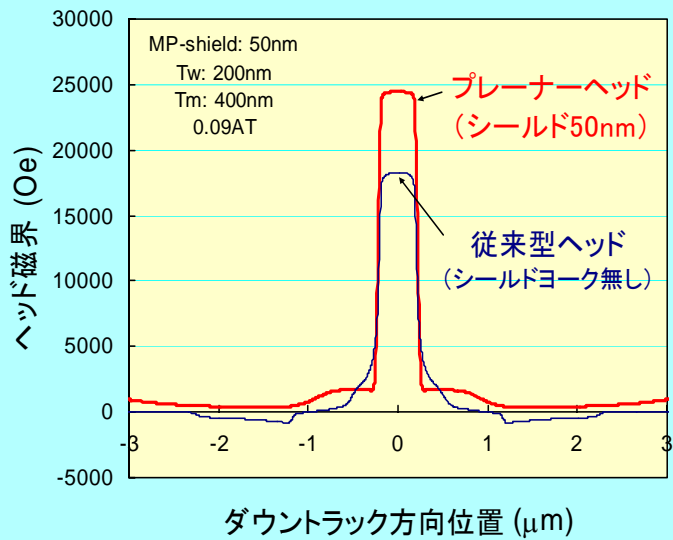
AITでの開発

プレーナヘッド

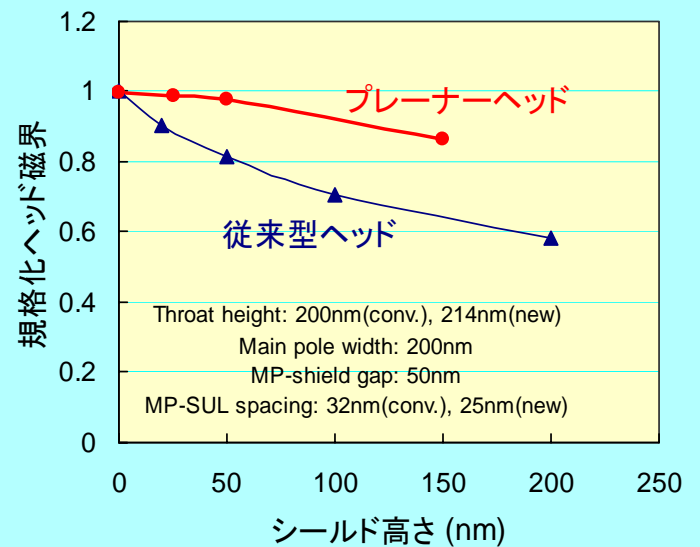


- ・強磁界
複合磁極面
+ゼロ・スロート
- ・急峻磁界
全方位シールド
- ・高精度作製技術
MEMS 技術

ヘッド磁界の特徴

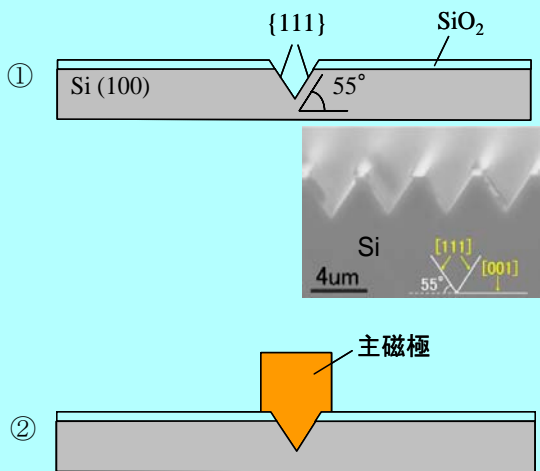


プレーナヘッドは、複合磁極面型の主磁極を採用し、スロート高さもゼロであることから、従来型ヘッドに比べて著しく大きな磁界が得られる。

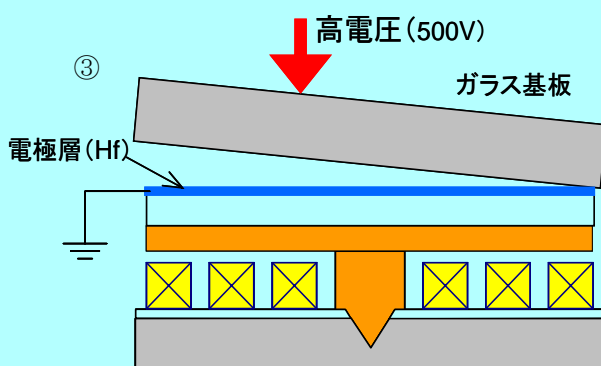


シールドにより一般に磁界強度は低下するが、プレーナヘッドではその程度が小さく、強磁界が実現し易い。

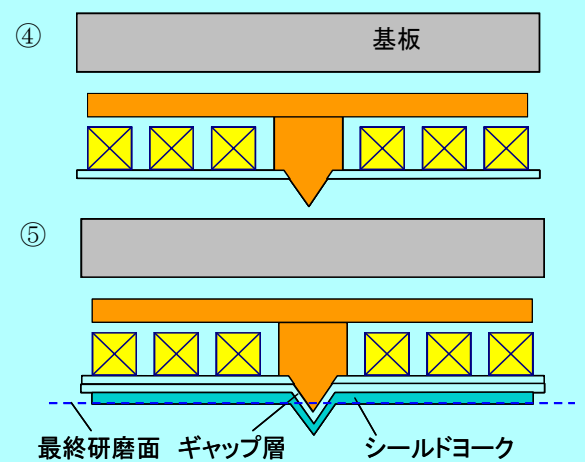
作製技術の特徴



Si 異方性エッチングにより高精度な溝形成し、これをテンプレートとして主磁極を形成する。



金属薄膜を製膜してこれを電極とし、ガラス基板と陽極接合を行う。



Si を溶解除去して主磁極先端部を露出し、非磁性ギャップ層、シールドヨーク層を製膜し、最後に先端突出部を研磨除去して完成する。

